

9 ダイオキシン類関係

9-(1) 耐容一日摂取量 (TDI)

ヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される1日体重1kg当たりのダイオキシン類摂取量

ダイオキシン類の当面の耐容一日摂取量(TDI)を4pg-TEQ/kg(体重)/日とする。

9-(2) 環境基準(環境中のダイオキシン類濃度の基準)

大気: 0.6pg-TEQ/m³以下(年平均値)

水質: 1pg-TEQ/L以下(年平均値)

底質: 150pg-TEQ/g以下

土壤: 1000pg-TEQ/g以下

9-(3) 排出基準(排出ガス・排出水に係るダイオキシン類の規制基準)

ア 大気排出基準

(ア) 鉄鋼業焼結施設

| 新設施設 | 既存施設 | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| H12.1.15～ | ～H14.11.30 | H14.12.1～ |
| 0.1ng-TEQ/m ³ | 2ng-TEQ/m ³ | 1ng-TEQ/m ³ |

(イ) 製鋼用電気炉

| 新設施設 | 既存施設 | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| H12.1.15～ | ～H14.11.30 | H14.12.1～ |
| 0.5ng-TEQ/m ³ | 20ng-TEQ/m ³ | 5ng-TEQ/m ³ |

(ウ) 亜鉛回収施設

| 新設施設 | 既存施設 | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| H12.1.15～ | ～H14.11.30 | H14.12.1～ |
| 1ng-TEQ/m ³ | 40ng-TEQ/m ³ | 10ng-TEQ/m ³ |

(エ) アルミニウム合金製造施設

| 新設施設 | 既存施設 | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| H12.1.15～ | ～H14.11.30 | H14.12.1～ |
| 1ng-TEQ/m ³ | 20ng-TEQ/m ³ | 5ng-TEQ/m ³ |

(オ) 廃棄物焼却炉(火床面積0.5m²以上又は焼却能力50kg/h以上)

| 規模 | 新設施設 | 既存施設 | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | H12.1.15～ | ～H13.1.14 | H13.1.15～ H14.11.30 | H14.12.1～ |
| 4t/h以上 | 0.1ng-TEQ/m ³ | | | 1ng-TEQ/m ³ |
| 2～4t/h未満 | 1ng-TEQ/m ³ | 基準の適用を猶予 | 80ng-TEQ/m ³ | 5ng-TEQ/m ³ |
| 2t/h未満 | 5ng-TEQ/m ³ | | | 10ng-TEQ/m ³ |

イ 水質排出基準

| 特 定 施 設 種 類 | 排出基準 |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 ・ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 ・ 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・ アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・ 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・ 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 ・ カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 ・ クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 ・ 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 ・ 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ・ ジオキサンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 ・ アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・ 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・ 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)から金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 ・ 廃棄物焼却炉(火床面積 0.5m²以上又は焼却能力 50kg/h 以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 ・ 廃 PCB 等又は PCB 処理物の分解施設及び PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設 ・ フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・ 下水道終末処理施設(水質基準対象施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) ・ 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 | 10pg-TEQ/L |

ウ 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理基準

| | | | |
|------------|---|--------------|-------------|
| 対象物 基 準 | ばいじん及び焼却灰その他の燃えがら、廃ガス洗浄施設汚泥、これらの廃棄物を処分するために処理したもの | | |
| | 新 設 施 設 | 既 存 施 設 | |
| | H12. 1. 15～ | ～H14. 11. 30 | H14. 12. 1～ |
| | 3ng-TEQ/g | 基準の適用を猶予 | 3ng-TEQ/g※ |

※ セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては基準を適用しない。

エ 廃棄物最終処分場の維持管理基準

| | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 対象施設 放流水の 基 準 | 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場 | | |
| | 新 設 施 設 | 既 存 施 設 | |
| | H12. 1. 15～ | ～H13. 1. 14 | H13. 1. 15～ |
| | 10pg-TEQ/L | 基準の適用を猶予 | 10pg-TEQ/L |